# 紫外吸収分光法を用いた高温ガス濃度計測装置の開発

㈱四国総合研究所 電子技術部 朝日一平 杉本幸代 星野礼香 二宮英樹 ㈱長峰製作所 長峰 勝 高地一美 萱原祥仁 黒田眞司 藤井達也 山地貴史 中元優介 井上 拓 ㈱テクノ・サクセス 戸井 弘 福田和秀

キーワード :	紫外吸収分光法	Key Words :	Ultra-violet absorption spectroscopy
	ガス濃度計測		Gas concentration measurement
	高温ガス		High temperature gas
	硫黄酸化物		SOx
	窒素酸化物		NOx
	アンモニア		$NH_3$

### Development of high temperature gas concentration measurement system by ultraviolet absorption spectroscopy

Shikoku Research Institute, Inc., Electronics Technology Department

Ippei Asahi, Sachiyo Sugimoto, Ayako Hoshino, Hideki Ninomiya

Nagamine Manufacturing Co., Ltd.

Masaru Nagamine, Kazumi Takachi, Yoshihito Kayahara, Shinji Kuroda, Tatsuya Fujii, Takafumi Yamaji

Yusuke Nakamoto, Taku Inoue

Techno-Success, Inc.

Hiroshi Doi, Kazuhide Fukuta

#### Abstract

A compact, low-cost gas measurement and monitoring system using ultraviolet absorption spectroscopy was developed. The system consists of the main body, which includes the light source and receiver, a sensor chip, and a monitor for display and control. The sensor chip is connected to the light source and receiver by a heat-resistant optical fiber. The dimension of the main body is  $213 \times 125 \times 75$  mm, and its weight is 1460 g. The sensor chip, whose dimension is  $30 \times 67 \times 13$  mm, is mounted on a ceramic optical bench along with optical components made of quartz, which enables the sensor to be used in a high temperature environment. The system can measure SO<sub>2</sub> or NH<sub>3</sub> with a detection limit of less than 1 ppm. This sensor can operate at a temperature of 200 °C, so the system can be applied to measurement and monitoring of exhaust gas in high temperature furnaces.

### 1. 序論

近年,各種プラント等における合理化・省エネ ルギ化や,次世代エネルギ利用の推進等に伴い, ガス計測技術の高度化,具体的には装置の小型・ 低コスト化に加え,高感度化,対象ガス種のマル チ化,応答の高速化などが強く求められている。 これまでに著者らは,光学的計測原理と各種微細 加工技術の融合により,これらの高度化を実現す るガスセンサシステムに関する研究開発及び製 品化研究を進めてきた<sup>[1]</sup>。ここでは,各種熱機関 の排気ガス成分測定や,大気環境モニタリングと してニーズの高い NH<sub>3</sub>, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>や,工業,医 療分野に用いられる各種有機化合物を対象に開 発した,紫外吸収分光法に基づく小型光学式マル チガスセンサについて,研究開発の成果及び製品 モデルの性能等について報告する。

## 2. 計測原理



図1 吸収分光法の概念

図1に示すように,吸収分光法は,観測空間を 透過した光を分光測定し,対象分子によって吸収 された場合のスペクトルと対象分子が存在しな い場合のスペクトルを比較することによって,分 子種とその密度または濃度を求める手法である。 ある特定の分子により吸収され,分光装置に導入 される光強度は, Beer-Lambert の法則として(1) 式で表される<sup>[2]</sup>。

 $I(\lambda) = I_0(\lambda)e^{-n\sigma(\lambda)L} \qquad (1)$ 

ここで, *I*(*λ*)は,対象分子が存在する場合の光 強度,*I*<sub>0</sub>(*λ*)は,対象分子が存在しない場合の光強 度, n は対象分子の密度(単位体積当たりの分子数) $[cm^{-3}]$ ,  $\sigma(\lambda)$ は吸収断面積 $[cm^2]$ , L は光路長[cm]である。吸収断面積は、分子による光の吸収量の指標となる。ガス濃度 cは、単位体積当たりの総分子数を $N[cm^{-3}]$ として $c=n/N\times10^{6}[ppm]$ により求められる<sup>[2]</sup>。



図2 分子のエネルギ準位と吸収バンド

物質による光の吸収は,分子の励起エネルギに 一致した電磁波の入射に伴い, 分子内のエネルギ 状態がある準位から他の準位へ遷移することに より生じる。分子のエネルギ状態は電子準位,振 動準位,回転準位などにより規定され,図2に示 すように,各電子準位には幾つかの振動準位が, 更に各振動準位には幾つかの回転順位が存在す る。即ち、物質が吸収する電磁波の波長域につい てみると, 準位間エネルギが高い電子準位間遷移 では紫外から可視域,振動準位間遷移では赤外域, 回転準位間遷移では電波帯となる。高温ガス濃度 計測を目的としたガス分析計として,市販されて いる製品の多くは、分子の振動準位間遷移、即ち 赤外領域における光の吸収を用いた装置である。 これは、比較的波長が長い光源を用いることで、 計測時に対象ガスと共に観測空間に存在する煤 塵等の微粒子の影響を抑制できること, 半導体レ ーザを主体として光源の選択性が高いことなど による。しかしながら,赤外域には観測空間に通 常存在する H2O の吸収が広範囲にあり、その干 渉を防ぐための方策が必須となる。また, 高感度 検出を実現するためには、場合によりメートルオ ーダ以上の長い光路長が必要になるため,必然的 に装置が大型且つ高価になる。これに対し、本研 究では紫外領域における光吸収に注目する。図3



図3 深紫外域における各種分子の吸収断面積

に示す紫外領域 (200~250nm)に吸収をもつ物質 の代表例をみると、高温ガス濃度計測において対 象となる多くの化合物が吸収を示す一方で,H2O の吸収は存在しない。また,吸収断面積oについ てみると、例えば NH3は 200~215nm において 10<sup>-17</sup>cm<sup>2</sup> オーダとなっている。一方,赤外域 (1.5µm帯)では 10<sup>-22</sup>cm<sup>2</sup>オーダである<sup>[3]</sup>ため、単 純に比較すると紫外領域の吸収が 105 倍程度感 度が高い,即ち光路長を105分の1程度まで縮小 でき,装置の大幅な小型化が実現できる可能性が 示唆される。また,近年では,小型重水素ランプ や深紫外 LED など,汎用性の高い紫外光源や, 紫外線の照射によって生じる光学的な劣化を抑 制する紫外線用の各種光学部品の開発が進んで いる。これらを総合的に勘案し、本研究では紫外 吸収分光法を原理として用い, 測定部に耐熱性材 料を適用することで高温環境への適用を可能と する,小型且つ低コストなガス濃度計測装置の研 究開発を行った。機能として既存のガス分析計と 同等以上を目指し、検出対象を、電気事業等にお いて比較的ニーズの高い SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>, NO<sub>x</sub> を中 心とするマルチガス成分とし、検出限界を SO<sub>2</sub>, NH<sub>3</sub>について 1ppm, 耐熱温度 200℃以上を目標 とした。

# 3. 装置構成

### 3.1 概 要

図4に,本研究における装置構成の概要を示す。 光学的計測手法を用いた高温ガス中の成分濃度 分析における計測方式は,観測空間内に光送受信 光学系を配置する直接挿入型と,観測空間から高



# 図 4 紫外吸収分光法を用いたガス濃度計測 装置の構成

温ガスをサンプリングし,煤塵や水蒸気等計測を 阻害する要因を除去・調整した後,光送受信光学 系内に配置されたガスセルへ導入するサンプリ ング型に大別される。

図4に示すように、本装置は、光源・受光器等 の主要機器が格納された本体と、観測空間に配置 し、対象ガスへの光の照射および透過光の受光を 行うセンサチップ及び、計測結果の表示と装置の 制御を行う制御・表示部により構成され、センサ チップに耐熱性をもたせることで、高温ガスの計 測が可能となる。本装置構成では、センサチップ を観測空間へ配置することで直接計測型に適用 でき、ガスセル内にセンサチップを組込むことで サンプリング型に適用することができる。光源か ら照射された紫外光は、送信光ファイバによりセ ンサチップへ伝送され、センサチップ上において 被検ガスによる吸収作用を経て、受信光ファイバ により小型分光器へ導入される。出力信号は任意 の PC により演算処理・表示される。

#### 3.2 センサチップの構成

本装置では、被検ガス雰囲気中を紫外光が伝搬 する距離が長い程感度が向上する。一方、センサ チップは小型である程用途は拡大する。両者を満 たすためには、センサチップ上において紫外光を 反射し、往復させる必要があるが、一般的な光学 ミラー等の反射素子は耐熱性の制約により用い ることができない。ここでは、プリズムの全反射 によって光路を曲げ、センサチップ内において紫 外光を複数回伝搬させることにより、光路長を確 保した。図5は、製作したセンサチップの光学系 構成の一例(光路長 320mm モデル)であり、図6



図 5 センサチップの構造例 (光路長 320mm モデル)



図 6 センサチップ上における光路 (光路長 320mm モデル)

は同センサチップ上における紫外光の光路を示 す。

図5に示すように、送信光ファイバからコリメ ートレンズ(シグマ光機社製、合成石英製球面平 凸レンズ、SLSQ-05-12P)を介してセンサチップ 上に放射された紫外光は、4 個のプリズム (THORLABS 社製、UV 溶融石英直角プリズム、 PS610×3、シグマ光機社製、合成石英製 45° 直 角プリズム、RPSQ07-2L×1)により、センサチ ップ上を上下段各 4 回通過し、320mmの光路長 を経て、カップリングレンズ(シグマ光機社製、 合成石英製球面平凸レンズ、SLSQ-05-15P)によ り受信光ファイバへ結合される。同様の方式によ り、光路長が 80mm、160mm、320mm の 3 種 類のセンサチップをそれぞれ製作し、対象ガスの 濃度域により適当なセンサチップを用いること とした。

これらの反射を含む光学系を精度よく配置固 定し、高温に耐えうるベースとして、アルミナセ ラミックスを用いた精密光学ベンチを開発した。 アルミナは, セラミックスとしては一般的な材料 であり, 熱膨張率が低く, 高温時における相転移 等の特異現象も生じないため, 光学ベンチ材料に 適している。また, 光学ベンチは, 各種光学部品 を固定するため, 全体としては凹凸, 斜面等が混 在した複雑な形状をとなる。ここでは, 全体の構 造を複数の部品に分割し, 個々のパーツを金型を 用いた射出成形が可能な形状として設計した。こ れによって, 量産化への移行が容易となる。製作 したセンサチップの一例(光路長 320mm モデル) の外観を図 7 に示す。



図 7 耐熱センサチップ外観 (光路長 320mm モデル)

センサチップへの光の導入と, センサチップ上 を通過した光の伝送をファイバにより行うため, これらの光ファイバにも耐熱性を付加する必要 がある。ここでは、石英コア、石英クラッドの光 ファイバ素線(Ceram Optec 社製, Optran UV100/110, UV200/220)と、セラミックスフェ ルールをシリカ系耐熱接着剤で固定した耐熱光 ファイバを製作し、センサチップへ適用した。耐 熱光ファイバの構造と外観を図8に示す。セラミ ックスフェルールは、200℃以下で用いる場合、 汎用のジルコニアフェルール(THORLABS社製, Ø2.5 mm セラミック製フェルール, CF126-10, CF230-10) を適用し、より高温の雰囲気に適用 する場合はアルミナフェルール(長峰製作所社製, 特注仕様)を適用する。また、熱膨張率の低いシ リカ系接着(オーデック社製,セラマボンド, 618N)を用いることにより、高温時における部品 の膨張・変形による光ファイバの破損を防止し, 光伝送特性の変化を抑制した。製作した耐熱光フ

ァイバを高温炉内において対向配置により光結 合し,紫外光を伝送した場合における,伝送光強 度の温度依存性を図9に示す。



図8 耐熱光ファイバの構造(上)と外観(下)





図9に示すように、耐熱光ファイバの伝送特性 は、70℃~200℃の温度変化に影響を受けず、い ずれの波長においても安定した光伝送がなされ ていることがわかる。

これらの,石英製小型光学部品,セラミックス光 学ベンチ,耐熱光ファイバをシリカ系接着剤で接 合することにより,石英とセラミックスのみによ り構成される耐熱性を有する小型センサチップ が完成した。寸法は30×67×13mm,重量は52g である。本センサチップを用いることで,200℃ 以上の高温環境においても光送受信機能が維持 され、高感度ガス濃度計測が可能となる。

#### 3.3 システム構成

本装置は、光源に小型重水素ランプ光源(浜松ホトニクス社製、小型紫外-可視 S2D2 ファイバ 光源、L10671)、分光装置として、ガス濃度計測 の感度やマルチ計測機能を高めるために、観測す る波長領域を限定し、波長分解能と感度が最適化 された小型分光器(Ocean optics 社製、小型ファ イバ光学分光器, USB2000+)を用い、本体には、 これらとリチウムイオンバッテリーが内蔵され ている。分光装置からのスペクトル情報に関する 出力信号は、専用のソフトウェアがインストール されたタブレット PC等の任意の電算機に送信さ れ、演算処理、表示がなされる。

本手法では,前述のとおりある一つの波長に注 目し,対象成分が存在しない場合における透過光 スペクトル(以下基準スペクトル)と対象成分が 存在する場合における透過スペクトルにより吸 光度を求め,これを事前に取得したデータベース の値と比較することで,原理的にはガス濃度を求 めることができる。しかし,実際の計測の過程に おいては,光学部品の劣化など種々の要因により 基準スペクトルに時間変化が生じるケース,或い は混合ガス成分にブロードな吸収スペクトルを 示す物質が含まれるケースなどが考えられ,これ らの場合,単一波長における値のみを用いる方法 ではガス濃度の計測が困難になる。したがって, 本装置では、吸光度パターンの山(以下ピーク波 長)と谷(以下ボトム波長)に注目し, それぞれの波 長における基準スペクトルとの比を用いて,分子 密度を求める手法をとる。図 10 に NH3 ガスの場 合における本手法の適用例を示す。

図 10 の場合, NH<sub>3</sub> の吸光度のピーク波長 (A:204.8nm)とボトム波長(B:206.9nm)の差をと り, 光路長 L, 吸収断面積 σ(データベース)を用 いて,

$$n = \frac{lnB - lnA}{L \cdot (\sigma_{@204.8nm} - \sigma_{@206.9nm})} \tag{3}$$

により比較することで分子密度を求めた。この時, 吸光度の測定値が自然対数による値であるか常 用対数による値であるかに留意が必要である。ま た,吸収断面積は温度依存性を有するため,観測

-23-



図 10 NH3計測における濃度演算手法

空間の温度域に合わせ,データベースを取得して おく必要がある。

本体にセンサチップ(光路長 80mm モデル)を 接続した本装置外観を図 11 に示す。



図 11 装置外観

本体寸法は 213×125×75mm, 重量 1460g(バ ッテリー含む)であり, 十分に携帯可能である。 これにより, 市販の光学式ガス分析計と比較して 大幅な小型軽量化が実現された。

#### 4. 機能試験

本装置を用いて、ガス濃度計測機能試験を行った。室温環境において、ガスセル内にセンサチップを配置し、セル内に導入したガスの設定濃度値と、計測結果を比較した。ガス種は NH<sub>3</sub>(N<sub>2</sub>ベース、5ppm 標準ガス)、及び SO<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>ベース、10ppm 標準ガス)とし、導入するガス濃度は、100%N<sub>2</sub> ガスとの流量比を調整することにより制御した。

本装置により得られた NH<sub>3</sub>及び SO<sub>2</sub>の吸光度 パターンを図 12,図 13 に示す。



図 13 計測結果: SO2 吸光度パターン

図 12, 13 により,両ガスとも紫外領域における特徴的な吸光度パターンが極めて良好に取得されていることがわかる。これらの結果に基づき,NH<sub>3</sub>について 204.8nm のピーク値を,SO<sub>2</sub>について 207.5nm のピーク値を設定濃度値と比較した結果を図 14 に示す。



図 14 計測結果:吸光度のガス濃度依存性

図 14 により、本装置により得られた吸光度パ ターンのピーク値が、ガス濃度に対し極めて良好

-24-

な線形性を示すことが検証された。相関係数はい ずれも 0.99 以上である。また、これらの結果か ら、検出限界 1ppm が十分に達成されていること がわかる。

次に混合ガスについてマルチガス濃度計測機 能試験を行った。ガス種は燃焼機関排気ガス成分 を模擬し、SO<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>ベース、1200ppm標準ガス)、 NO(N<sub>2</sub>ベース、1000ppm標準ガス)、NO<sub>2</sub>(N<sub>2</sub>ベ ース、200ppm標準ガス)を用い、これらを混合 してガスセルに導入した場合における、各ガスの 設定濃度値と、測定値の比較を行った。

混合ガスから得られる吸光度パターンを基に マルチガス計測を行う手法は,想定される温度, 圧力等の環境条件において,使用する装置による 対象分子種すべての吸光度データベースが取得 されていることを前提として,

- 各ガスの吸光度パターンから、干渉がない 或いは影響が少ない波長域を選択し、混合ガ スにより得られた吸光度パターンから濃度を 特定できるガス種の吸光度パターンを順次差 し引くことにより、全種のガス濃度を求める。
- ② 混合ガスの成分数に合わせた複数の波長における吸光度に注目し、得られる連立方程式を解き、全種のガス濃度を求める。
- ③ 予め混合ガスのスペクトルパターンをデ ータベース化しておき、多変量解析により全 種のガス濃度を求める。

などの手法が用いられる。現行の製品の多くは③ の手法によりマルチガス計測が行われているが, ここでは,①の手法によりマルチガス計測を行っ た。

混合ガスにより得られた吸光度パターン及び, データベースに基づき分離した SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub> の吸光度パターンを図 15 に,各ガスの設定濃度 値と計測結果から得られる濃度値との比較を表 1 にそれぞれ示す。なお,濃度の演算に用いた波 長は,SO<sub>2</sub>について 300.47nm, 301.72nm, NO について 212.47nm, 213.52nm, NO<sub>2</sub>について 231.59nm であり,SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>の順に定量 化を行った。

図 15 により、本手法を用いて、混合ガスの吸 光度パターンから、各ガスの吸光度パターンを分 離することができ、表1により、測定値と設定値 が良好に一致していることが確認された。ここで、



図 15 SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>混合ガスの 吸光度パターン

表1 混合ガス濃度計測結果

	$\mathrm{SO}_2$	NO	$NO_2$	
設定値	940	40	10	
[ppm]	240	40	40	
測定値	240.6	40.6	47.9	
[ppm]				

本実験では,濃度制御にフロート式流量計を用い ているため,設定値には仕様上の誤差が含まれて いることに留意が必要である。また,混合ガスの 成分濃度計測においては,成分の組合せやその濃 度比によって,適用する手法に詳細な検討が必要 である。

紫外吸収分光法を用いた計測ではこれまでに, 数百 ppm オーダの高濃度 SO<sub>2</sub> 中における数 ppm オーダの微量 NH<sub>3</sub> 計測を行う手法<sup>[2]</sup>,高濃度 3 種混合成分からマルチ濃度計測を行う手法<sup>[13]</sup>な どが報告されているが,混合ガス条件や環境条件 に合わせ,上述の①~③等から最適な手法を選定 し,用いる必要がある。

#### 5. 高温ガス濃度計測試験

本装置を用いて,高温ガス濃度計測試験を行った。対象ガスは,石炭ガス化炉により生成される高温混合ガスである。混合成分は,NH<sub>3</sub>,C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>,H<sub>2</sub>Sの3種について計測を行った。NH<sub>3</sub>については,既設のガスクロによる測定値との比較を行ったが,他の2種についてはモニタリングがなされていないため,本装置による計測結果のみとなる。

対象ガスは,前処理としてフィルタによる煤塵

除去がなされており,結露防止のため200℃で温 調されている。センサチップは光路長160mmタ イプを用い,高温ガス導入用のガスセル内に配置 した。ガスセルは200℃に加温した。計測環境の 圧力は大気圧である。高温ガス導入用のガスセル の構造及び外観を図16に示す。





図 16 高温ガス導入用のガスセルの構造(上) と外観(下)

基準スペクトルは,計測直前にガスセル内に Ar ガスを導入し取得した。

本試験により得られた高温ガスの吸収スペク トル及び吸光度パターンを図 17 に,また,対象 3 成分のガス濃度のトレンドグラフを図 18 に示 す。なお,ガス濃度は,NH<sub>3</sub>については事前に取 得したデータベースによる本装置の測定値を示 す。その他 2 種については,文献値(HITRAN デ ータベース)に基づく値を用いたものであるため, 参考値に留まる。



# 図 18 高温雰囲気における NH<sub>3</sub>, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, H<sub>2</sub>S 濃 度トレンドグラフ

図 17 により、本装置を用いて、高温ガス中に おいても光送受信機能が維持され、良好に吸収ス ペクトルが取得できることがわかる。図 18 によ り、3 成分のガス濃度を同時に計測されているこ と、NH<sub>3</sub>については既設のガスクロによる指示値 と良い一致を示すことがわかる。また、本装置を 用いることで、既設の分析計に対し5倍以上の高 い時間分解能が実現されていることがわかる。

以上から,本装置による高温ガスを対象とした マルチガス濃度計測機能が検証された。

#### 5. 結 論

紫外吸収分光法を用いて,高温雰囲気中におけ るマルチガス濃度計測を目的とした,小型且つ低 コストなガスセンサに関する研究開発を行い,以 下の成果を得た。

- 本体寸法 213×125×75mm, 重量 1460g, センサチップ寸法 30×67×13mm, 重量 52g により構成されるガス濃度計測装置を開発 し,既存のガス分析計に対し大幅な小型化, 低コスト化を実現した。
- (2) 本装置を用いて、光路長 320mmのセンサ チップにより NH<sub>3</sub>及び SO<sub>2</sub>ガスの検出限界 1ppm 以下が実現可能であることを検証した。
- (3) 室温環境において、SO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub> によ る混合ガス濃度計測を行い、それぞれのガス 濃度を同時に定量化できることを検証した。
- (4) 200℃の高温環境において混合ガス濃度計 測を行い、光送受信が良好に機能すること及 び、それぞれのガスを分離して同時に定量化

# できることを確認した。

今後は,各種ガスのデータベースの整備やフィ ールド試験を実施し,既存のガス分析計の代替え を目指し,実用化研究を進める予定である。また, 工業・医療関係等,他分野への適用に向けた可能 性調査を進める予定である。

# [謝辞]

本研究の一部は,平成24・25年度経済産業省 「地域イノベーション創出実証研究補助事業:小 型光学式マルチガスセンサの製品化研究」の一環 として行われたものであり,ご協力いただいた関 係者各位に深く感謝の意を表します。

#### [参考文献]

[1] 朝日 一平, 杉本 幸代, 二宮 英樹, 下川 房 男, 高尾 英邦, 大平 文和, 筒井 靖之, 林 宏樹, 今野 隆: "マイクロマシン技術を用いた小型光学 式マルチガスセンサ [II]: ラマン散乱型と紫外吸 収分光型ガスセンサの特性", 電気学会論文誌 E, センサ・マイクロマシン部門誌, Vol.133, No.9, pp. 260-266(2013)

[2] 福地哲生,二宮英樹:"高濃度 SO<sub>2</sub>含有ガス 中における微量 NH<sub>3</sub>の紫外分光測定",電気学会 論文誌 A,基礎・材料・共通部門誌, Vol.131, No.7, pp. 540-546(2011)

[3] F. Chen, D. judge, C. Wu, J. Caldwell :"Low and room temperature photo absorption cross sections of NH<sub>3</sub> in the UV region", P*lanetary & Space Sci.*, Vol.47, pp.261-266 (1999)

[4] HITRAN database : NH<sub>3</sub>, Cheng (2006), 298K, 140-230nm

[5] HITRAN database : SO<sub>2</sub>, Vattulainen (1997), 293K, 195-350nm

[6] HITRAN database : NO, Thompson (1963), 298K, 186-227nm

[7] HITRAN database : NO<sub>2</sub>, Schneider (1987), 298K, 200-710nm

[8] HITRAN database : H<sub>2</sub>S, WuChen (1998),
295K, 160-260nm

[9] HITRAN database : Cl<sub>2</sub>, Hubinger Nee (1995), 298K, 190-500nm

[10] HITRAN database : CO<sub>2</sub>, Shemansky (1972), 298K, 169.57-300.00nm

[11] HITRAN database : O<sub>2</sub>, Yoshino (1992), 300K, 199.8-202.6nm

[12] HITRAN database : OCS, Wu(1999), 295K, 200-260nm

[13] N. Higashi, H. Yokota, S. Hiraki, Y. Ozaki: "Direct Determination of Peracetic Acid, Hydrogen Peroxide, and Acetic Acid in Disinfectant Solutions by Far- Ultraviolet Absorption Spectroscopy", *Anal. Chem.*, Vol.77, No.7, pp.2272-2277 (2005)